

【 支援装置料金表<データ提供あり> 】2025年7月1日 改定

北海道大学 ナノテクノロジー連携研究推進室

AHM装置番号	装置名	メーカー	型式	基本料			利用料(1時間あたり)			技術補助料		技術代行料	
				学外者	学外者(大学・公的機関)	学外者(一般)	学外者(大学・公的機関)	学外者(一般)	学外者(大学・公的機関)	学外者(一般)	学外者(大学・公的機関)	学外者(一般)	学外者(大学・公的機関)
AP-200001	超高精度電子ビーム描画装置 125kV	エリオニクス	ELS-F125-U	35,200	7,500	21,200	11,900	25,600	16,300	30,000			
AP-200002	超高精度電子ビーム描画装置 100 kV	エリオニクス	ELS-7000HM	35,200	5,900	19,300	10,300	23,700	14,700	28,100			
AP-200003	マスクアライナー	ミカサ	MA-20	13,200	1,400	2,100	5,800	6,500	10,200	10,900			
AP-200004	レーザー描画装置	ネオアーク	DDB-201-200	22,000	900	3,000	5,300	7,400	9,700	11,800			
AP-200005	真空蒸着装置	サンバック	ED-1500R	22,000	1,600	2,100	6,000	6,500	10,400	10,900			
AP-200006	プラズマCVD装置	サムコ	PD-220ESN	22,000	3,000	5,800	7,400	10,200	11,800	14,600			
AP-200007	液体ソースプラズマCVD装置	サムコ	PD-10C1	22,000	700	800	5,100	5,200	9,500	9,600			
AP-200008	ヘリコンスパッタリング装置	アルバック	MPS-4000C1/HC1	13,200	4,100	5,400	8,500	9,800	12,900	14,200			
AP-200009	イオンビームスパッタ装置	アルバック	IBS-6000S	13,200	1,600	2,100	6,000	6,500	10,400	10,900			
AP-200010	原子層堆積装置(ALD)	Picosun	SUNALE-R	13,200	3,100	5,200	7,500	9,600	11,900	14,000			
AP-200012	反応性イオンエッチング装置 RIE-101PH	サムコ	RIE-101PH4	13,200	2,900	5,000	7,300	9,400	11,700	13,800			
AP-200013	反応性イオンエッチング装置 RIE-10NRV	サムコ	RIE-10NRV	13,200	2,900	4,700	7,300	9,100	11,700	13,500			
AP-200014	ドライエッチング装置	アルバック	NLD-500	13,200	1,200	1,800	5,600	6,200	10,000	10,600			
AP-200015	イオンミリング装置	アルバック	IBE-6000S	13,200	1,300	1,700	5,700	6,100	10,100	10,500			
AP-200017	電界放射型走査型電子顕微鏡	日本電子	JSM-6700FT	22,000	1,300	1,300	5,700	5,700	10,100	10,100			
AP-200018	電子ビーム描画装置	エリオニクス	ELS-3700	26,400	1,000	1,800	5,400	6,200	9,800	10,600			
AP-200019	電子線描画装置	エリオニクス	ELS-7300(ERA-8000FE)	70,400	1,800	5,100	6,200	9,500	10,600	13,900			
AP-200020	両面マスクアライナ	ズースマイクロテック	MA-6	17,600	1,000	2,900	5,400	7,300	9,800	11,700			
AP-200021	ECR加工装置	エリオニクス	EIS-200ER	44,000	1,000	1,500	5,400	5,900	9,800	10,300			
AP-200022	ICP加工装置	エリオニクス	EIS-700S	26,400	1,100	1,100	5,500	5,500	9,900	9,900			
AP-200023	超高真空5級ヘリコンスパッタ	菅製作所	Av-28	26,400	1,400	2,500	5,800	6,900	10,200	11,300			
AP-200024	ALD製膜装置	Cambridge NanoTech	Savannah 100	26,400	1,500	2,800	5,900	7,200	10,300	11,600			
AP-200026	スパッタ装置	キヤノンアネルバ	SPP-210H	26,400	300	500	4,700	4,900	9,100	9,300			
AP-200027	EB加熱・抵抗加熱蒸着装置	アルバック	EBX-8C	35,200	2,600	2,900	7,000	7,300	11,400	11,700			
AP-200028	EB加熱・抵抗加熱蒸着装置	菅製作所	AV096-000	17,600	2,000	3,100	6,400	7,500	10,800	11,900			
AP-200034	ショットキー電界放射型走査型電子顕微鏡(FE-SEM)	日本電子	JSM-6500F	35,200	2,500	4,500	6,900	8,900	11,300	13,300			
AP-200035	超真空・極低温・高磁場SPM/MLT-UHV-SPM	日本電子	JAFM4500LT	26,400	1,600	7,000	6,000	11,400	10,400	15,800			
AP-200036	超高圧電子顕微鏡群	日本電子	JEM-ARM1300	70,400	3,900	5,300	8,300	9,700	12,700	14,100			
AP-200039	電界放射型電子顕微鏡(200kV FEG-TEM)	日本電子	JEM-2010F	70,400	2,600	2,700	7,000	7,100	11,400	11,500			
AP-200041	超薄膜評価装置	日立	HD-2000	17,600	2,800	7,300	7,200	11,700	11,600	16,100			
AP-200042	集束イオンビーム加工観察装置	日立	FB-2100	22,000	2,500	4,900	6,900	9,300	11,300	13,700			
AP-200043	透過電子顕微鏡(TEM)	日本電子	JEM2010	35,200	2,400	4,600	6,800	9,000	11,200	13,400			
AP-200045	フィールドエミッション電子プローブ・マイクロアナライザ(FE-EPMA)	日本電子	JXA-8530F	35,200	3,800	8,600	8,200	13,000	12,600	17,400			
AP-200046	複合ビーム加工観察装置(FIB-SEM)	日本電子	JIB-4601F	35,200	3,600	5,800	8,000	10,200	12,400	14,600			
AP-200047	複合ビーム加工観察装置(FIB-SEM/EDS-EBSDオプション)	日本電子	JEI-9000IB-EBSD(optional)		0	400	800	400	800	400	800		
AP-200052	オージェ電子分光装置	日本電子	JAMP-9500F	35,200	2,400	7,900	6,800	12,300	11,200	16,700			
AP-200053	X線光電子分光装置 JPS-9200	日本電子	JPS-9200	35,200	1,900	5,500	6,300	9,900	10,700	14,300			
AP-200054	スピンSEM	エイコー・エス・ニアランド	—	26,400	2,500	2,800	6,900	7,200	11,300	11,600			
AP-200055	超高真空STM・スピン偏極STM装置	オミクロン	STM/AFM,VT-STM	26,400	3,700	5,200	8,100	9,600	12,500	14,000			
AP-200056	時間分解光電子顕微鏡システム	エルミテック	PEEM-III	140,800	2,700	5,600	7,100	10,000	11,500	14,400			
AP-200057	ナノカーボン成長炉	Nano Device社	Easy tube system	44,000	400	500	4,800	4,900	9,200	9,300			
AP-200058	エリブノメータ	日本分光社	M-500S	6,200	200	700	4,600	5,100	9,000	9,500			
AP-200059	超高速・スキャン高精度電子ビーム露光装置 130kV	エリオニクス	ELS-F130HM	35,200	9,600	29,300	14,000	33,700	18,400	38,100			
AP-200060	半導体薄膜堆積装置(PLD)	バスカル	PAC-LMBE	35,200	2,700	6,100	7,100	10,500	11,500	14,900			
AP-200061	高分解能3次元構造評価装置	日本FEI	Titan3 G2 60-300	70,400	7,600	30,000	12,000	34,400	16,400	38,800			
AP-200062	収差補正走査型透過電子顕微鏡	日本電子	JEM-ARM200F	44,000	5,600	16,400	10,000	20,800	14,400	25,200			
AP-200063	電子線3次元粗さ解析装置	エリオニクス	ERA-8000FE	35,200	1,300	1,300	5,700	5,700	10,100	10,100			
AP-200064	走査型プローブ顕微鏡	NanoScan Station SPM/AFM	—	35,200	200	400	4,600	4,800	9,000	9,200			
AP-200065	超高真空AFM	日本電子	JAFM-4500XT	211,200	1,400	1,800	5,800	6,200	10,200	10,600			
AP-200066	コンパクトスパッタ装置	アルバック	ACS-4000-C3-HS	13,200	3,700	5,500	8,100	9,900	12,500	14,300			
AP-200067	ICP高密度プラズマエッチング装置	サムコ	RIE-101HHS	13,200	2,700	6,500	7,100	10,900	11,500	15,300			
AP-200068	スパッタ装置	菅製作所	SSP3000Plus	26,400	700	1,600	5,100	6,000	9,500	10,400			
AP-200069	ダインングソー	DISCO	DAD322	17,600	700	1,000	5,100	5,400	9,500	9,800			
AP-200070	大気中光電子分光装置	理研計器	AC-3	13,200	2,200	4,200	6,600	8,600	11,000	13,000			
AP-200071	超高分解能走査型電子顕微鏡	日立ハイテク・ロジーズ	SLR230	26,400	2,500	4,700	6,900	9,100	11,300	13,500			
AP-200072	多元素スパッタ装置	アルバック	QAM-4-ST	26,400	5,800	7,300	10,200	11,700	14,600	16,100			
AP-200073	シリコン深堀りエッチング装置	SPPテクノロジーズ	AFV-ASE-Pegasus-Polstar	35,200	4,900	10,100	9,300	14,500	13,700	18,900			
AP-200074	電子ビーム蒸着装置	エイコー・エス・ニアランド	EB-580S	26,400	2,400	3,200	6,800	7,600	11,200	12,000			
AP-200075	レーザー顕微鏡	キーエンス	VK-9700/9710	26,400	700	1,400	5,100	5,800	9,500	10,200			
AP-200076	UV-オゾンクリーナー	サムコ	UV-1	8,800	600	600	5,000	5,000	9,400	9,400			
AP-200077	光学干渉式膜厚計	フィルメトリクス	F20-UV	26,400	700	900	5,100	5,300	9,500	9,700			
AP-200078	原子層堆積装置(粉末対応型)	ピコサン	R-200 advanced	26,400	4,900	8,200	9,300	12,600	13,700	17,000			
AP-200079	精密イオンミリングシステム	Gatan	PHPSII model 695	35,200	1,300	1,400	5,700	5,800	10,100	10,200			
AP-200080	レーザー描画装置	パイル・マイクロシステムズ	DWL66H-K	35,200	5,100	8,700	9,500	13,100	13,900	17,500			
AP-200081	集束イオンビーム加工観察装置	日本電子	JEM-9320FIB		0	2,200	4,900	6,600	9,300	11,000	13,700		
AP-200082	X線光電子分光装置	日本電子	JPS-9200	30,800	1,800	5,500	6,200	9,900	10,600	14,300			
AP-200083	プラズマ式原子層堆積装置	サムコ	AD-230LP-H	35,200	6,300	12,200	10,700	16,600	15,100	21,000			
AP-200084	点上型ランプ加熱装置	アドバンス理工	MILA-5000-P-N	35,200	1,800	1,900	6,200	6,300	10,600	10,700			
AP-200085	量子・電子制御ナノメトリック顕微鏡性能測定装置	日本電子	JEM-ARM200F NEOARM	35,200	4,800	11,700	9,200	16,100	13,600	20,500			
AP-200086	ガラスインプリント装置	芝浦機械	GMP-415V	35,200	2,200	4,800	6,600	9,200	11,000	13,600			
AP-200087	顕微鏡外可視分光装置	日本分光	MSV-5200	8,800	2,100	3,200	6,500	7,600	10,900	12,000			
AP-200088	微細形状測定機	小坂研究所	ET200	17,600	600	800	5,000	5,200	9,400	9,600			
AP-200089	マニュアルスパッタ	(自作)	-	17,600	700	1,200	5,100	5,600	9,500	10,000			
AP-200090	ラマンイメージング装置	堀場製作所	RRE-Evolution type jia nano	26,400	2,900	4,200	7,300	8,600	11,700	13,000			
AP-200091	ショットキー電界放射型走査型電子顕微鏡(FE-SEM)	日本電子	JSM7200F	8,800	2,700	4,300	7,100	8,700	11,500	13,100			
AP-200092	触針式プロファイラー(段差計)	KLA-Tencor	Alpha-Step D-500	26,400	400	700	4,800	5,100	9,200	9,500			
AP-200093	紫外可視近赤外分光光度計(積分球付き)	島津製作所	UV-3600 Plus / MPC-603A	26,400	800	1,300	5,200	5,700	9,600	10,100			
AP-200094	分光蛍光光度計	日立ハイテック	F-7100	26,400	800	1,300	5,200	5,700	9,600	10,100			
AP-200095	フッ化キセノイドライエッチング装置	サムコ	VPE-4F	8,800	1,900	2,700	6,300	7,100	10,700	11,500			
AP-200096	電子線・レーザー顕微鏡光検出システム(アブラウエック)	GentlSys	BEAMER Pro	8,800	1,300	2,600	5,700	7,000	10,100	11,400			

技術支援料 (サンプル前処理・設計等)	技術相談料
4,400円 / 時間	11,000円 / 時間
(ただし、高度な知識及び経験が必要とされる作業、複数の技術を組み合わせる作業、その他の難易度の高い作業を行う場合にあっては18,800円)	

北海道大学 ナノテクノロジー連携研究推進室

技術支援料（サンプル前処理・設計等）	技術相談料
4,400円 / 時間	11,000円 / 時間
（ただし、高度な知識及び経験を必要とされる作業、複数の技術を組み合わせる作業、その他の難易度の高い作業を伴う場合にあつては8,800円）	